

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2017年8月31日(31.08.2017)

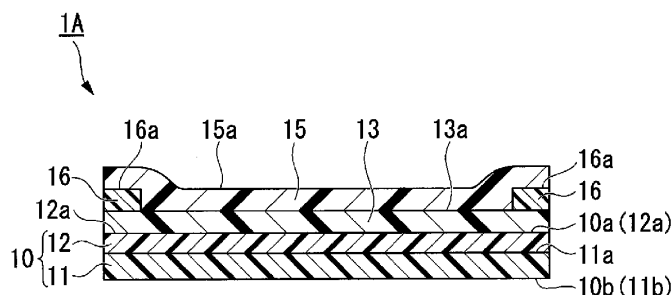


(10) 国際公開番号  
WO 2017/145938 A1

- (51) 国際特許分類:  
H01L 21/301 (2006.01) C09J 201/00 (2006.01)  
C09J 7/02 (2006.01) H01L 21/60 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2017/005937
- (22) 国際出願日: 2017年2月17日(17.02.2017)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2016-031343 2016年2月22日(22.02.2016) JP
- (71) 出願人: リンテック株式会社(LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町2-3番2-3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 山本 大輔(YAMAMOTO Daisuke); 〒1730001 東京都板橋区本町2-3番2-3号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 米山 裕之(YONEYAMA Hiroyuki); 〒1730001 東京都板橋区本町2-3番2-3号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小橋 力也(KOBASHI Rikiya); 〒1730001 東京都板橋区本町2-3番2-3号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 志賀 正武, 外(SHIGA Masatake et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロピア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: PROTECTIVE FILM FORMATION SHEET, MANUFACTURING METHOD FOR PROTECTIVE FILM FORMATION SHEET, AND MANUFACTURING METHOD FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 保護膜形成用シート、保護膜形成用シートの製造方法及び半導体装置の製造方法



(57) Abstract: Provided is a protective film formation sheet in which: a protective film formation layer is provided on a support sheet; a peeling film is provided on the protective film formation layer; the surface roughness of the surface of the support sheet opposite to the side provided with the protective film formation layer is 0.5  $\mu\text{m}$  or less; and the static frictional force measured according to JIS K7125 between the surface of the support sheet with the surface roughness of 0.5  $\mu\text{m}$  or less and the surface of the peeling film opposite to the side provided with the protective film formation layer is 29N or less.

(57) 要約: 支持シート上に保護膜形成層を備え、この保護膜形成層上に剥離フィルムを備えてなり、この支持シートにおけるこの保護膜形成層を備えている側とは反対側の表面の表面粗さが0.5  $\mu\text{m}$ 以下であり、この支持シートにおけるこの表面と、この剥離フィルムにおけるこの保護膜形成層を備えている側とは反対側の表面と、の間における、JIS K7125に準拠して測定された静止摩擦力が29N以下である、保護膜形成用シート。

WO 2017/145938 A1